

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年10月20日 (20.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/097470 A1

(51) 国際特許分類⁷: B29C 59/02, G11B 7/26 // B29L 17:00

士見 6 丁目 1 番 1 号 パイオニア株式会社 総合研究所
Saitama (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/005043

(74) 代理人: 藤村 元彦 (FUJIMURA, Motohiko); 〒1040045
東京都中央区築地 4 丁目 1 番 17 号 銀座大野ビル
藤村国際特許事務所 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2005 年 3 月 15 日 (15.03.2005)

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) 国際出願の言語: 日本語

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-098132 2004 年 3 月 30 日 (30.03.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): パイオニア株式会社 (PIONEER CORPORATION) [JP/JP];
〒1538654 東京都目黒区目黒 1 丁目 4 番 1 号 Tokyo
(JP).

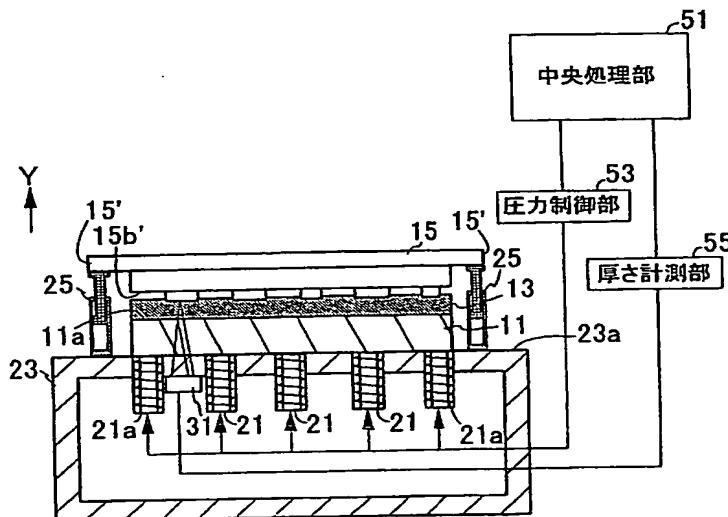
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 加園 修 (KASONO, Osamu) [JP/JP]; 〒3502288 埼玉県鶴ヶ島市富

(続葉有)

(54) Title: PATTERN TRANSFER DEVICE AND PATTERN TRANSFER METHOD

(54) 発明の名称: パターン転写装置及びパターン転写方法



51 CENTRAL PROCESSING SECTION
53 PRESSURE CONTROL SECTION
55 THICKNESS MEASURING SECTION

WO 2005/097470 A1

(57) Abstract: A pattern transfer device for transferring a protruding/recessed pattern formed on the surface of a transfer die accurately to a transferring article. The pattern transfer device applies the transfer die having a protruding/recessed pattern to the transferring article on a substrate thus transferring the protruding/recessed pattern to the surface of the transferring article. The pattern transfer device is characterized by being provided with a means for pressing the transfer die against the transferring article on the substrate for each of a plurality of different positions.

(続葉有)



BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(57) 要約: 転写型の表面に形成された凹凸パターンを正確に被転写物に転写することを目的とする。本発明によるパターン転写装置は、凹凸パターンを有する転写型を基板上の被転写物に衝合させて被転写物の表面に凹凸パターンを転写するパターン転写装置である。ここで、転写型を複数の異なる箇所毎に転写型を基板上の被転写物に押し付ける押付手段を備えることを特徴とする。